



## NU-262 プラズマ誘起CVD装置

サムコ社製 PD-220N

### 登録ファイル



**PDL (Process Data Log) ファイル ※必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、  
**成膜条件を入力してください**)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



成膜時の基板配置の撮影画像など  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff) **必須ではありません**



### 添付ファイル



無し

### 原則、実施日毎の登録をお願いします。

- ・一日に複数のサンプルを作製した場合は、複数ファイルを同時に登録することを推奨します。  
試料番号を入れるなど後で識別できるファイル名で保存し、登録ファイルへ**一度に登録**してください。
- ・**成膜の内容が大幅に異なる場合**は、別々に登録（**連続登録**）を行ってください。ユーザーの裁量で分け方を決めていただいて構いません。（**連続登録**：データ登録マニュアル[5/7]）

※ 登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。

(追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください)

### 【成膜後、段差計NU-220,NU-261などで膜厚測定を行った場合】

PDLへ膜厚を入力し、登録するファイル名の末尾に、計測装置の装置番号を入れて  
ください。（ファイル名の例：20251001〇〇成膜\_NU-220測定）

RDEデータ登録後に段差計で測定された場合は、以下担当者までご連絡ください。



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦

2025/11/07